

JEOL Plasma Equipment

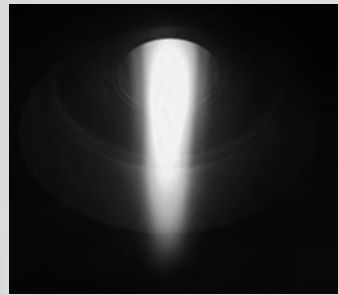
超高温・高純度・高反応場

高周波誘導熱プラズマ装置 TP series

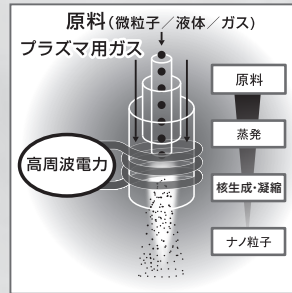


TP-40020NPS

高周波誘導により生成する約10,000度の熱プラズマを利用し、瞬時に蒸発や溶融、反応や改質など、急速加熱から急冷による材料プロセッシングが可能です。



Ar+H₂プラズマ



用途例

- ナノ粒子や複合粒子、球状粒子の作製
- 微粉末・ナノ粒子の化学合成や反応、改質
- 厚膜合成、溶射、CVD
- 有害ガス分解
- 溶解

高密度プラズマ発生用 プラズマ銃

BS-800 series

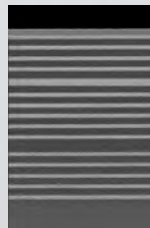
真空内に低電圧・大電流の高密度プラズマを発生させるプラズマ源です。大型チャンバーにも搭載できます。真空蒸着に付加してプラズマアシスト蒸着（イオンプレーティング）を行い膜質を高める事ができます。
(緻密性、平滑性、密着性、耐環境性等の改善)
反応性蒸着も可能です。

真空蒸着法



TiO₂/SiO₂多層膜の断面SEM画像

プラズマ銃付加



BS-80011BPG

プラズマ発生用 高周波電源

RF-120 series

- スパッタ、CVD、エッチング等に利用される13.56MHzの高周波電源です。
(ラインナップ：750W～6kW)
- パターン運転、アークカット/カウント機能、過去データ記憶など標準装備。
- 各電源と組み合わせる整合装置もご用意しています。



RF-12020

RF-56000



日本電子株式会社 産業機器営業部

TEL : 03-6262-3570

E-mail : sales-ieg@jeol.co.jp

URL : http://www.jeol.co.jp/products/list_depo.html